【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第４区分
【発行日】平成19年5月24日(2007.5.24)

【公表番号】特表2003-500783(P2003-500783A)
【公表日】平成15年1月7日(2003.1.7)
【出願番号】特願2000-618974(P2000-618974)
【国際特許分類】
Ｇ１１Ｂ　7/26　(2006.01)
Ｃ２３Ｃ　14/34　(2006.01)
Ｇ１１Ｂ　7/254　(2006.01)
Ｇ１１Ｂ　7/257　(2006.01)
Ｇ１１Ｂ　7/24　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｇ１１Ｂ　7/26　５３１
Ｃ２３Ｃ　14/34　Ｒ
Ｇ１１Ｂ　7/24　５３４Ｋ
Ｇ１１Ｂ　7/24　５３４Ｎ
Ｇ１１Ｂ　7/24　５３５Ｂ
Ｇ１１Ｂ　7/24　５３５Ｃ
Ｇ１１Ｂ　7/24　５３５Ｇ

【手続補正書】
【提出日】平成19年3月28日(2007.3.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】特許請求の範囲
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】　非対称の成層構造を有する記録ディスクを製造するための方法であって、
所与のスペクトル帯域において透明な第一の基盤（１）を設けるステップと、
反射膜システム（６）を含む層の構成を前記第一の基盤の第一の側に与えるステップと、
周囲から第二の側を保護するための保護膜システムを前記基盤の前記第二の側に与えるステップとを備え、前記保護膜システムは、オキシ窒化ケイ素および化学量論的組成下の酸化ケイ素のうち少なくとも一つから成る少なくとも一つの層を備える、方法。
【請求項２】　前記スペクトル帯域において半透過性を有する膜システム（２）を与えることと、前記スペクトル帯域において透明な第二の基盤（５）を与えることとによって、前記反射膜システム（６）を含む前記構成を与えるステップをさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項３】　前記半透過膜システムの少なくとも一つの層と、前記反射膜システムの少なくとも一つの層と、前記保護膜システムの前記少なくとも一つの層とを真空蒸着プロセスによって与えるステップをさらに備える、請求項２に記載の方法。
【請求項４】　前記半透過膜システムの少なくとも一つの層と、前記反射膜システムの少なくとも一つの層と、前記保護膜システムの前記少なくとも一つの層とをスパッタリングによって被着するステップをさらに備える、請求項２に記載の方法。
【請求項５】　前記反射膜システムの少なくとも一つの層と、前記保護膜システムの前記少なくとも一つの層とを真空蒸着プロセスで与えるステップをさらに備える、請求項

１に記載の方法。

【請求項６】　前記反射膜システムの少なくとも一つの層と、前記保護膜システムの前記少なくとも一つの層とをスパッタリングによって被着するステップをさらに備える、請求項１に記載の方法。

【請求項７】　前記第一の透明な基盤の材料の屈折率と等しいように前記保護膜システムの前記少なくとも一つの層の材料の屈折率を選択するステップをさらに備える、請求項１に記載の方法。

【請求項８】　前記保護膜システムの前記少なくとも一つの層の屈折率ｎを１．４７≦ｎ≦１．７であるように選択するステップをさらに備える、請求項１に記載の方法。

【請求項９】　１．５≦ｎ≦１．６を選択するステップをさらに備える、請求項８に記載の方法。

【請求項１０】　前記保護膜システムの前記少なくとも一つの層の屈折率ｎを高くとも１．５７であるように選択するステップをさらに備える、請求項１に記載の方法。

【請求項１１】　前記保護膜システムの前記少なくとも一つの層の吸光定数ｋを10^{-4}≦ｋ≦5×10^{-3}であるように選択するステップをさらに備える、請求項１に記載の方法。

【請求項１２】　前記保護膜システムの前記少なくとも一つの層の吸光定数ｋを高くとも10^{-3}であるように選択するステップをさらに備える、請求項１に記載の方法。

【請求項１３】　前記保護膜システムの前記少なくとも一つの層をケイ素ターゲットの反応性スパッタリングによって被着するステップをさらに備える、請求項１に記載の方法。

【請求項１４】　厚さが少なくとも１０ｎｍである前記保護膜システムを被着するステップをさらに備える、請求項１に記載の方法。

【請求項１５】　厚さが少なくとも５０ｎｍである前記保護膜システムを被着するステップをさらに備える、請求項１に記載の方法。

【請求項１６】　前記保護膜システムの前記少なくとも一つの層は、化学量論的組成下の酸化ケイ素を備える、請求項１に記載の方法。

【請求項１７】　保護膜システムの前記少なくとも一つの層は、オキシ窒化ケイ素を備える、請求項１に記載の方法。

【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】図面の簡単な説明
【補正方法】変更
【補正の内容】
【図面の簡単な説明】

【図１】　スーパーオーディオＣＤとしても知られている通例の構造のハイブリッドディスクの部分断面図である。

【図２】　本発明によるハイブリッドディスクの図１と同じ部分断面図である。

【図３】　保護膜が化学量論的組成の二酸化ケイ素（ａ）または化学量論的組成下の酸化ケイ素（ｂ）から成るハイブリッドディスクに生ずるラジアル振れを被着された防湿膜厚さと相関して示したグラフである。